

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年7月5日(2012.7.5)

【公開番号】特開2011-44546(P2011-44546A)

【公開日】平成23年3月3日(2011.3.3)

【年通号数】公開・登録公報2011-009

【出願番号】特願2009-191093(P2009-191093)

【国際特許分類】

H 01 L 21/02 (2006.01)

H 01 L 21/3205 (2006.01)

H 01 L 23/522 (2006.01)

H 01 L 21/768 (2006.01)

H 01 L 23/532 (2006.01)

H 01 L 21/28 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/02 C

H 01 L 21/88 J

H 01 L 21/88 R

H 01 L 21/28 3 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年5月23日(2012.5.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 2】

次に、図6に示すように、無電解めっきにより、拡散バリア層16上にNi合金層(第2の金属層)18を形成する。この際、Pd活性化処理を前処理として行なうことにより、置換還元性の拡散バリア層16の無電解めっきを実行できる。また、Ni合金層18をNi-Pから構成し、その厚さを0.3μmにする。なお、拡散バリア層16がPdから構成される場合、前処理のPd活性化処理を省略できる。